

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成19年11月29日(2007.11.29)

【公開番号】特開2006-112788(P2006-112788A)

【公開日】平成18年4月27日(2006.4.27)

【年通号数】公開・登録公報2006-017

【出願番号】特願2004-297158(P2004-297158)

【国際特許分類】

G 0 1 B 11/24 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 1 B 11/24 A

H 0 1 L 21/30 5 1 6 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月11日(2007.10.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の表面近傍に配置され、該表面の高さ変化に応じて位置が変化する複数の非光学的検出素子を配列して構成される高さ検出器と、

該非光学的検出素子に向けて測定光を発する光源と、

前記非光学的検出素子からの前記測定光の反射光を受光することにより前記非光学的検出素子の位置を光学的に検出する光検出器とを有することを特徴とする表面形状計測装置。

【請求項2】

基板を所定距離まで近接させた場合にその高さ変化に応じて原子間力に基づきつつ位置が変化する複数の非光学的検出素子に向けて前記基板を前記所定距離以下まで近接させるステップと、

前記非光学的検出素子に測定光を入射するステップと、

前記非光学的検出素子からの前記測定光の反射光を光検出器により受光するステップと、

該光検出器による受光位置に基づいて、前記非光学的検出素子の位置を算出するステップとを有することを特徴とする表面形状計測方法。

【請求項3】

露光光源からの露光光をレチクル上に導く照明光学系と、

前記レチクルを駆動するレチクル駆動系と、

前記レチクル上のパターンを前記基板上に投影する投影光学系と、

該基板を駆動する基板駆動系と、

請求項1又は2に記載の表面形状計測装置とを有することを特徴とする露光装置。

【請求項4】

請求項3に記載の露光装置によって基板にパターンを投影露光する工程と、

投影露光された前記基板を現像する工程とを有するデバイスの製造方法。

(2)

JP 2006-112788 A5 2007.11.29